

【公報種別】 特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】 第 3 部門第 3 区分
 【発行日】 令和 6 年 5 月 9 日 (2024.5.9)

【国際公開番号】 WO2023/022123
 【出願番号】 特願 2023-542395 (P2023-542395)
 【国際特許分類】
 C 0 8 G 73/22 (2006.01)
 H 0 5 K 1/03 (2006.01)
 【F I】
 C 0 8 G 73/22
 H 0 5 K 1/03 6 1 0 N

10

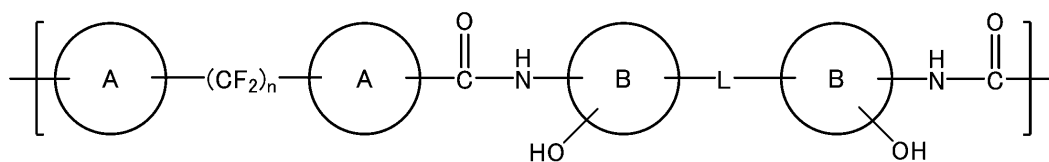
【手続補正書】
 【提出日】 令和 6 年 2 月 15 日 (2024.2.15)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】 特許請求の範囲
 【補正対象項目名】 全文
 【補正方法】 変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

20

式 (1) で示される繰り返し単位を有する含フッ素ポリアミド化合物。

式 (1) :

【化 4 4】



30

(式 (1) 中、 n は 1 ~ 8 の整数、 L は $-SO_2-$ 、 $-O-$ 、 $-CO-$ 、2 価の非フッ素化有機基または 2 価のフッ素化有機基、環 A および環 B は、独立に、炭化水素環を表す。)

【請求項 2】

環 A が、シクロヘキサン環、ベンゼン環、ナフタレン環、ビフェニル環、アントラセン環またはターフェニル環である請求項 1 に記載の含フッ素ポリアミド化合物。

【請求項 3】

環 B が、シクロヘキサン環、ベンゼン環、ナフタレン環、ビフェニル環、アントラセン環またはターフェニル環である請求項 1 または 2 に記載の含フッ素ポリアミド化合物。

40

【請求項 4】

式 (1) で示される繰り返し単位が、式 (1-1) で示される繰り返し単位である請求項 1 または 2 に記載の含フッ素ポリアミド化合物。

式 (1-1) :

50

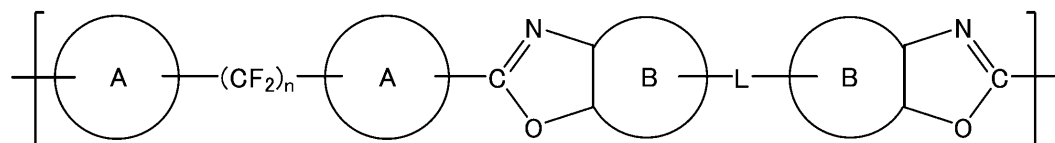
[illegible]

【請求項 5】

10

式（２）で示される繰り返し単位を有する含フッ素ポリベンゾオキサゾール。

【化 4 6】



20

【請求項 7】

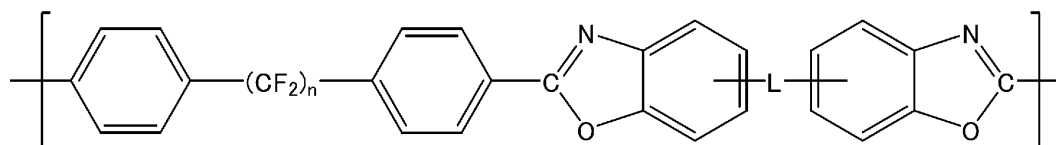
【請求項 8】

30

【請求項 9】

式 (2-1) :

【化 4 7】



40

【請求項 10】

【請求項 1 1】

50

載の含フッ素ポリベンゾオキサゾールを含有する低誘電材料。

【請求項 1 2】

請求項 1 または 2 に記載の含フッ素ポリアミド化合物、または、請求項 6 または 7 に記載の含フッ素ポリベンゾオキサゾールを含有するプリント基板の絶縁材料。

10

20

30

40

50